



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets



(11)

EP 2 192 209 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
06.04.2016 Patentblatt 2016/14

(51) Int Cl.:
C23G 5/00 (2006.01) **B08B 7/00 (2006.01)**
B23P 6/04 (2006.01) **F01D 5/00 (2006.01)**
F01D 25/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **09175543.9**

(22) Anmeldetag: **10.11.2009**

(54) **Vorrichtung zur Reinigung oxiderter oder korrodierter Bauteile in Gegenwart eines halogenhaltigen Gasgemisches**

Device for cleaning oxidized or corroded components in the presence of a halogenous gas mixture

Dispositif pour le nettoyage de composants oxydés ou corrodés en présence d'un mélange gazeux d'halogènes

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **17.11.2008 DE 102008043787
13.01.2009 US 352641**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.06.2010 Patentblatt 2010/22

(73) Patentinhaber: **ALSTOM Technology Ltd
5400 Baden (CH)**

(72) Erfinder:
• **Luttermann, Ansgar
CH-5400, Baden (CH)**

• **Stankowksi, Alexander
CH-5301, Siggenthal-Station (CH)**
• **Bindernagel, Karsten
DE-79761, Waldshut-Tiengen (DE)**

(74) Vertreter: **Bernotti, Andrea et al
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino (IT)**

(56) Entgegenhaltungen:
**EP-A2- 1 882 823 EP-B1- 0 209 307
JP-A- 2001 003 705**

EP 2 192 209 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Reinigung oxiderter oder korrodiert Bauteile in Gegenwart eines halogenhaltigen Gasgemisches, mit einem Reinigungsreaktor, in den mittel- oder unmittelbar eine Speiseleitung mündet, die über eine Durchflussregleinrichtung mit einem das halogenhaltige Gasgemisch bevoeratenden Gasreservoir verbunden ist. Insbesondere kann es sich bei diesen Bauteilen um von Heissgasen beaufschlagte Turbinenkomponenten, insbesondere Gasturbinenschaufeln, handeln.

Stand der Technik

[0002] Turbinenkomponenten für Triebwerke oder stationäre Gasturbinenanlagen, die mittel- oder unmittelbar Heissgasströmungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Leit- oder Laufschaufeln, Wärmestausegmente oder ähnliche den Heissgaskanal begrenzende Bauteile oder Bauteilgruppen unterliegen betriebsbedingten Materialdegradations, die häufig zu Rissen und damit verbunden zur mechanischen Schwächung der jeweiligen Komponenten führen. Aufgrund der in den Heissgaskanälen vorherrschenden hohen Temperatur- und Druckbelastungen, denen die entsprechenden zumeist aus Nickelbasiswerkstoffen gefertigten Bauteile ausgesetzt sind, scheiden sich mit zunehmender Betriebsdauer durch äußere und innere Oxidation komplexe chemisch und thermisch stabile Oxide an den Bauteiloberflächen, innerhalb der sich ausbildenden Rissöffnungen sowie in oberflächennahen Bereichen innerhalb des Basismaterials ab.

[0003] Ziel ist es, die derart beanspruchten und zum Teil beschädigten Bauteile mit einer speziellen Prozesskette in einen Zustand überführen, der weitgehend dem Zustand eines neu gefertigten, vergleichbaren Bauteils entspricht. Hierbei ist einer der Schritte, das zu überarbeitende Bauteil sorgfältig zu reinigen, d.h. die an der Bauteiloberfläche sowie in den sich ausgebildeten Rissen abgeschiedene komplexe Oxidschicht zu beseitigen, ohne dabei das Material des Bauteils selbst zu schädigen.

[0004] In der DE 28 10 598 A1 und der JP 2001 003705 A sind Reinigungsverfahren für die vorstehend bezeichneten Bauteile beschrieben, die einer druckbehafteten Reinigungsatmosphäre bei Temperaturen von über 1000°C ausgesetzt werden, in der gasförmige, aktive Fluoridionen enthalten sind. In Gegenwart einer derartigen Reinigungsatmosphäre setzt sich das komplexe Oxid unter Bildung eines gasförmigen Fluorids mit den Fluoridionen um, ohne dabei das Bauteilmaterial zu schädigen. Derartige auch allgemein als FIC (Fluorid Ion Cleaning) bezeichnete Reinigungsverfahren sind häniglich bekannt und in vielfachen Publikationen beschrieben. Repräsentativ sei in diesem Zusammenhang

auf die EP 0 209 307 B1 verwiesen, aus der eine beachtliche Übersicht der bis anhin bekannten Reinigungstechnologien entnommen werden kann.

[0005] Aus der EP 1 882 823 A2 ist eine Vorrichtung zur Reinigung von Gasturbinen mit einer Flüssigkeit bekannt.

[0006] Weitgehend allen Bestrebungen zur Verbesserung derartiger FIC-Verfahren ist die Aufgabe gemeinsam, Oxidschichtanteile, die sich insbesondere in rissbedingten Spalt- oder Grabenstrukturen abgeschieden haben, vollständig zu beseitigen, zumal bereits geringste Restanteile oxiderter oder korrodiert Oberflächen nachhaltige Auswirkungen auf anschließende Reparaturmaßnahmen haben. Typischerweise erfolgt zu Zwecken der Rissheilung an den jeweils gereinigten Bauteilen ein Lö- oder Schweißvorgang derart, dass über einem gereinigten Riss eine Reparaturlegierung in Pulverform angehäuft wird, die in Gegenwart von Vakuum und unter Hitzeinwirkung zum Schmelzen und schließlich zum Fließen in den spaltförmigen Riss gebracht wird. Hierbei bildet sich eine Benetzung der Risswand mit der verflüssigten Reparaturlegierung aus. Es liegt auf der Hand, dass entsprechende Benetzungen an einer mit einer Oxidschicht behafteten Bauteiloberfläche nicht oder in einem weit geringeren Maß erfolgen, wodurch letztlich Reparaturschwachstellen entstehen, die es zu vermeiden gilt.

[0007] In der vorstehend zitierten EP 0 209 307 B1 wird zur Verbesserung des Reinigungserfolges vorgeschlagen, den Druck innerhalb der reaktiven Reinigungsatmosphäre zyklisch zu variieren, um auf diese Weise eine allgemeine Bewegung der reaktiven gasförmigen Fluoridionen im Bereich eines zu reinigenden Bauteils zu erzeugen zu dem Zwecke eines innigen Inkontaktbringens der gasförmigen Reaktionsmittel mit den Wandungen der Risse und Hohlräume innerhalb des geschädigten Bauteils.

[0008] In der DE 10 2005 051 310 A1 wird vorgeschlagen, die Reaktionskammer, in der zu Zwecken der Bauteilreinigung ein halogenhaltiges Gasgemisch eingebracht wird, zeitweise mit einem nicht halogenhaltigen Gas während der Reinigung zu spülen.

[0009] Die US 6,536,135 B2 beschreibt ein FIC-Verfahren, bei dem eine verbesserte Oxidreinigung durch Variation der Partialdrücke des Reinigungsgasgemisches vorgenommen wird, indem der aus Fluorwasserstoff (HF) und Wasserstoff (H₂) bestehenden Reinigungsgasmischung als weitere Komponente Kohlenstoff zugegeben wird. Der Kohlenstoff wird in Form verschiedener Verbindungen zugegeben, die während des Prozesses ein kohlenstoffhaltiges Gas bilden.

[0010] Ferner ist der Druckschrift ein typischer Reinigungsreaktor zu entnehmen, der ein zylinderförmiges Gehäuse vorsieht, das von oben gasdicht verschließbar ist und in einem geöffneten Zustand von oben mit zu reinigenden Bauteilen bestückt werden kann. Die zu reinigenden Bauteile werden auf vertikal übereinander vorgesehenen Ablageebenen, sogenannten Böden, unter-

gebracht, die an einem im Reinigungsreaktor mittig angeordneten Zentralrohr befestigt sind, durch das ein kohlenstoffangereichertes Fluorwasserstoff-Gasmisch dem Reinigungsreaktor zugeführt wird. Das den Reaktorkopf gasdicht durchdringende Zentralrohr erstreckt sich vertikal innerhalb des Reinigungsreaktors nach unten in den Bereich des sogenannten Reaktorsumpfes, in dem das Zentralrohr eine sich im wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Reinigungsreaktors erstreckende Gasverteilerstruktur mit Austrittsöffnungen vorsieht, über die das halogenhaltige Reinigungsgasmisch von unten nach oben aufsteigend in den Reinigungsreaktor eingespeist wird. Das Reinigungsgasmisch durchströmt dabei das gesamte Reaktorvolumen vom Reaktorsumpf in Richtung des Reaktorkopfes, an dem eine entsprechende Gausauslassöffnung vorgesehen ist.

[0011] Die Anmelderin hat darüber hinaus jahrelange praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Reinigung betriebsbedingt verunreinigter, korrodierter, oxidiert und degraderter Gasturbinenkomponenten der vorstehend erläuterten Art, insbesondere unter Verwendung von FIC-Reinigungsverfahren sowie der hierfür erforderlichen Reinigungsanlagen. Im langjährigen Umgang mit einem diesbezüglichen Reinigungsreaktor, der über ein Zentralrohr mit einem Reinigungsgasmisch gespeist wird, das Fluorwasserstoff und Wasserstoff in wechselnden Verhältnissen enthält, hat es sich gezeigt, dass erhebliche Störungen im Reinigungsprozess durch Mengenschwankungen in der Zuführung des Reinigungsgases in den Reinigungsreaktor verursacht werden, die fallweise bei Überschreiten gewisser Ausmaße bis zum Abbruch des gesamten Reinigungsprozesses führen können. Genauere Untersuchungen zeigten überdies, dass die Zuführung schwankender Fluorwasserstoffgasmenge innerhalb des Reinigungsreaktors zu Konzentrationsschwankungen führen, die letztlich eine reduzierte Reinigungseffizienz und damit verbunden eine nicht exakt steuerbare Reinigungsqualität zur Folge haben. Insbesondere bei sehr stark geschädigten Bauteilen mit einer großen Anzahl von Materialrissen, die darüber hinaus ein breites Spektrum hinsichtlich Tiefe, Breite und Länge der einzelnen Risse aufweisen, kann ein angestrebter Reinigungsgrad unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet werden. Auf die Konsequenzen einer unvollständigen Reinigung von mit einer Schicht komplexer Oxide überzogenen Bauteilen ist bereits vorstehend hingewiesen worden.

[0012] Ein weiterer nachteiliger und daher verbessерungsbedürftiger Aspekt bei den bislang angewandten Reinigungspraktiken betrifft den Aufbau des Reinigungsreaktors. Bereits in Verbindung mit der vorstehend zitierten US 6,536,135 B2 sind einerseits auf die Einströmung des Reinigungsgases in den Reinigungsreaktor mittels des zentral geführten Zentralrohres und einer im Tels des zentral geführten Zentralrohres und einer im Bodensumpfbereich des Reaktors vorgesehenen Verteilerstruktur, als auch auf die Positionier- und Ablagemöglichkeiten der einzelnen zu reinigenden Bauteile auf den

längs des Zentralrohrs in vertikaler Abfolge vorgesehene Ablageböden hingewiesen worden. Aufgrund einer derartigen bekannten Konstruktion sind die Ablage- bzw. Positionierungsmöglichkeiten für die einzelnen zu reinigenden Bauteile innerhalb des Reinigungsreaktors beschränkt. Hinzu kommen die gleichfalls verbessерungsbedürftigen Anströmungsverhältnisse der einzelnen zu reinigenden Bauteile innerhalb des Reinigungsreaktors, zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund einer gegenseitigen Abschattung bestimmter Oberflächenbereiche an den zu reinigenden Bauteilen nur eine unzureichende Beaufschlagung mit Reinigungsgas erfolgt. So ist nicht auszuschließen, dass sich durch eine ausschließlich im Reaktorsumpfbereich vorgesehene Reinigungsgaseinspeisung Bereiche mit vergleichsweise schlechten Strömungs- und Konzentrationsverhältnissen bis hin zu Totwassergebieten ausbilden, durch die insbesondere in Bereichen von Rissen ein geringerer Gasaustausch initiiert wird.

[0013] Versuche, zur Begegnung der vorstehend aufgezeigten Probleme in Bezug auf die Verbesserung der Reinigungsqualität die Reinigungszykluszeiten zu erhöhen, um eine längere Wechselwirkungsdauer zwischen den zu reinigenden Bauteilen und dem Reinigungsgasmisch zu erhalten, erbrachten nur geringfügige Erfolge. Zudem wurden Reinigungsprozesse mit einer erhöhten HF-Konzentration durchgeführt. Doch zeigten diese Bestrebungen lediglich, dass sich die gesetzten Reinigungsziele nicht in zufriedenstellendem Maße einstellten. Vielmehr führten diese Maßnahmen zu einer Kostenhöhung sowie einem erhöhten Materialangriff auf die zu reinigenden Bauteile.

Darstellung der Erfindung

[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Reinigung oxidiert oder korrodierter Bauteile, insbesondere von Heissgasen ausgesetzten Gasturbinenkomponenten, in Gegenwart eines halogenhaltigen Gases, mit einem in der Regel kesselförmig ausgebildeten Reinigungsreaktor, in den mittel- oder unmittelbar eine Speiseleitung einmündet, die über eine Durchflussregleinrichtung mit einem das halogenhaltige Gas bevorratenden Reservoir verbunden ist, derart weiterzubilden, dass einerseits dafür Sorge getragen wird, dass die in Verbindung mit einer unzureichenden bzw. schwankenden Reinigungsgaszufuhr in den Reinigungsreaktor verbundenen Probleme vollständig beseitigt werden. Andererseits gilt es, Maßnahmen zu treffen, die gewährleisten, dass jedes einzelne in den Reinigungsreaktor einzubringende zu reinigende Bauteil einer unmittelbaren Anströmung mit dem Reinigungsgas ausgesetzt wird, so dass sich möglichst keine Abschattungseffekte sowie auch keine Strömungstoträume innerhalb der Gasströmung ausbilden können. Sämtliche zu treffenden Maßnahmen sollen zudem unter dem Aspekt wirtschaftlicher Überlegungen und einer möglichst schonenden, aber effektiven Reinigung jedes einzelnen Bauteils

getroffen werden.

[0015] Die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe ist im vorliegenden Anspruch 1 angegeben. Den Erfindungsgedanken vorteilhaft weiterbildende Maßnahmen sind Gegenstand der Unteransprüche, darüber hinaus der weiteren Beschreibung sowie den Ausführungsbeispielen zu entnehmen.

[0016] Die lösungsgemäße Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1 zeichnet sich dadurch aus, dass die Durchflussregeleinrichtung in Abfolge längs der Durchströmungsrichtung des die Speiseleitung durchströmenden halogenhaltigen Gases ein Gasmengenregelventil, eine Wärmetauschereinheit sowie eine Gasmengenmesseinheit vorsieht.

[0017] Der lösungsgemäßen Vorrichtung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich längs der Speiseleitung für die Zuführung des halogenhaltigen Gases Kondensationen ausbilden, die insbesondere im Bereich von Drosselstellen auftreten. Derartige Kondensationen führen im Bereich der Gasmengenregelung zu fehlerhaften Werten und können bis hin zum Totalausfall der Mengenmessung führen. Das halogenhaltige Gas wird vorzugsweise in Druckflaschen bevoorraet. Unter den Lagerbedingungen liegt es flüssig vor. Durch Erhöhen der Temperatur wird die Flüssigkeit verdampft, und es stellt sich der temperaturabhängige Dampfdruck des Stoffes ein. Vor der Gasregelung herrschen somit Überdruckbedingungen. Der Druck innerhalb des Reinigungsreaktors liegt typischerweise im Druckniveau von 50 Torr bis 780 Torr. Deshalb bedarf es längs der Speiseleitung wenigstens einer druckreduzierenden Drosselstufe. Bei dieser tritt die vorstehende Kondensationsproblematik auf. Die lösungsgemäße Vorrichtung enthält als Drosselstelle längs der Speiseleitung wenigstens eine Durchflussregeleinrichtung, die ein das Gas expandierendes Gasmengenregelventil vorsieht. Zur Begegnung der sich hierbei ausbildenden Kondensation ist in Strömungsrichtung dem Gasmengenregelventil unmittelbar nachfolgend eine Beheizungseinheit vorgesehen, die vorzugsweise einen Gaserhitzer aufweist, wodurch das Temperaturniveau in diesem Leitungsbereich über das Kondensationsniveau des halogenhaltigen Gases, vorzugsweise von HF-Gas, gehoben wird. Stromab längs der Speiseleitung zum Wärmetauscher schließt sich unmittelbar die Gasmengenmesseinheit an. Mit Hilfe der lösungsgemäßen Maßnahme kann wirkungsvoll die Bildung von HF-Kondensat vermieden werden. Fehlmessungen sowie auch ein vollständiges Versagen der Durchflussregeleinrichtung können hiermit vollständig ausgeschlossen werden, wodurch sich zudem auch die Lebensdauer der einzelnen Komponenten der Durchflussregeleinrichtung deutlich erhöht. Dies wiederum hat eine positive Auswirkung auf die Anschaffungs- und Betriebskosten und verbessert darüber hinaus die Verfügbarkeit derartiger Reinigungsanlagen.

[0018] Grundsätzlich ist eine Beheizung des Wärmetauschers unter Einsatz verschiedenster Aufheiztechniken möglich. Als besonders vorteilhaft hat sich der Einsatz

einer elektrischen Beheizung erwiesen. Gleichsam ist es jedoch ebenso möglich, indirekt über entsprechend erhitzte Wärmeträger oder sonstige Heizmedien den Leistungsbereich stromab zum Gasmengenregelventil zu erhitzen. Für die in der Wärmetauschereinheit verwendeten Materialien, die Kontakt mit den halogenhaltigen Gasen haben, besteht die Forderung nach chemischer Beständigkeit gegenüber den aggressiven halogenhaltigen Gasen, vorzugsweise HF-Gas.

[0019] Die Wärmetauschereinheit ist in Bezug auf ihre Wärmeabgabe derart auszubilden bzw. auszuwählen, dass ein Temperaturniveau zwischen 22°C und 75°C, bevorzugt 40°C bis 50°C und insbesondere bevorzugt 44°C bis 46°C eingestellt werden kann.

[0020] In einer vorteilhaften Ausbildungsform ist stromauf und stromab zur Durchflussregeleinrichtung in der Speiseleitung jeweils ein Absperrventil vorgesehen, das bei einem eventuellen Ausfall der Durchflussregeleinrichtung jeweils automatisch oder manuell betätigbar ist. Um zu gewährleisten, dass der Reinigungsgaszufluss durch die Speiseleitung selbst in einem derartigen Fall gewährleistet bleibt, ist eine Bypass-Leitung zur Durchflussregeleinrichtung längs der Speiseleitung vorgesehen, längs der ein Regelventil, vorzugsweise ein Handregelventil, eingebracht ist.

[0021] Weitere Einzelheiten einer bevorzugten Ausführungsform bleiben der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren im Weiteren überlassen.

[0022] Um zu gewährleisten, dass die einzelnen innerhalb des Reinigungsreaktors zu reinigenden Bauteile im Interesse des Reinigungsprozesses von dem Reinigungsgas optimal angeströmt werden, zeichnet sich eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß dem Oberbegriff des vorliegenden Anspruches 4, die ein mit der wenigstens einen Speiseleitung mittel- oder unmittelbar verbundenes Zentralrohr vorsieht, das sich vom Reaktorkopf zum Reaktorsumpf innerhalb des Reinigungsreaktors erstreckt und im Bereich des Reaktorsumpfes mit einer sich radial zum Zentralrohr erstreckenden, ersten Verteilerstruktur verbunden ist, die über Austrittsöffnungen für das halogenhaltige Gas verfügt, lösungsgemäß dadurch aus, dass die erste Verteilerstruktur eine Auflageebene für die zu reinigenden Bauteile aufweist, und eine zweite Verteilerstruktur vorgesehen ist, die beabstandet zur ersten Verteilerstruktur am Zentralrohr angebracht ist. Die erste Verteilerstruktur bildet zugleich eine sich radial zum Zentralrohr erstreckende Auflageebene für die zu reinigenden Bauteile, wobei die Verteilerstrukturen zumindest in Richtung der auf ihnen aufliegenden Bauteile orientierte Austrittsöffnungen für das halogenhaltige Gas aufweisen.

[0023] Das neuartige Gasverteilungskonzept sieht die Anordnung von vorzugsweise mehreren längs des Zentralrohrs übereinander angeordneten so genannten Verteilerstrukturen vor, die entweder selbsttragend am Zentralrohr angebracht sind oder mit geeignet ausgebildeten Stützstrukturen längs des Zentralrohrs kombiniert sind.

[0024] In Abweichung zur bisherigen Reinigungsgase-

inspeisung, die direkt aus dem Zentralrohr radial nach aussen oder gemäss US 6536135 B2 im Bereich des Reaktorsumpfes erfolgt, sieht die neu konzipierte Gasverteilung eine längs des Zentralrohres jeweils in den Bereichen der Auflageebenen, auf denen die einzelnen zu reinigenden Bauteile aufliegen, jeweils individuelle Gaseinspeisungen vor. So dient die neuartige dezentrale Gasverteilung im Reinigungsreaktor dazu, das Prozessgas möglichst optimal zu verteilen, indem jeder einzelnen Komponente das Reinigungsgas unter weitgehend identischen Bedingungen zu- und wieder abgeführt wird. Aufgrund einer individuellen Reinigungsgaseinspeisung in jeder einzelnen Auflageebene für die zu reinigenden Bauteile wird gewährleistet, dass jedes einzelne Bauteil direkt und in geeigneter Weise mit Reinigungsgas beaufschlagt wird. Die Anzahl sowie die Anordnung der in der jeweiligen Verteilerstruktur vorgesehenen Austrittsöffnungen können grundsätzlich beliebig gewählt werden, vorzugsweise jedoch unter Berücksichtigung von Form, Größe und Anordnung der zu reinigenden Bauteile.

[0025] Die jeweils längs des Zentralrohrs mit axialem Abstand angebrachten Verteilerstrukturen, die je nach Ausbildung in stabile Stützstrukturen integriert oder in Form eigenstabilen Platten- oder Rohrkonstruktionen ausgebildet sein können, sind aus einem Material hergestellt, das beständig gegenüber dem in dem Reinigungsreaktor herrschenden Prozessbedingungen ist, vorzugsweise bietet sich hierfür IN600 (Inconel 600) an.

[0026] Je nach Reinigungsaufgabe sowie Größe und Anzahl der zu reinigenden Bauteile ist der Reinigungsreaktor mit einer geeigneten Anzahl längs zum Zentralrohr verteilt anzuordnender Verteilerstrukturen zu bestücken, auf die die zu reinigenden Bauteile aufzubringen sind.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die einzelnen Verteilerstrukturen modular und unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Reinigungsaufgabe einbringbar. Hierzu weisen die Verteilerstrukturen eine mittige Manschette mit einer Manschettenöffnung zur Aufnahme des Zentralrohres auf. Mit Hilfe der Manschette lassen sich die einzelnen Verteilerstrukturen längs des Zentralrohrs positionieren und fixieren. Um den Abstand zwischen zwei längs des Zentralrohrs anzubringenden Verteilerstrukturen geeignet zu wählen, ist eine entsprechende Anzahl von zylinderförmigen Distanzmanschetten vorzusehen, die als Abstandshalter längs über das Zentralrohr geschoben werden und die mit den Verteilerstrukturen versehenen Manschetten längs des Zentralrohrs voneinander beabstandet fixieren.

[0028] Grundsätzlich lassen sich die jeweils radial von der Manschette erstreckenden Verteilerstrukturen in unterschiedlicher Weise ausbilden bzw. ausführen. Als besonders vorteilhaft haben sich platten- oder gitterförmige bzw. rohrförmige Ausbildungen für die Verteilerstruktur erwiesen. Im Falle der Ausbildung einer aus einzelnen Rohrstücken bzw. Rohrleitungen zusammengesetzten Verteilerstruktur ist wenigstens eine von dem Zentralrohr

radial verlaufende Stichleitung vorgesehen, von der radial zum Zentralrohr beabstandet wenigstens eine das Zentralrohr ringförmig umlaufende Ringleitung angebracht ist. Die jeweiligen Austrittsöffnungen sind längs der wenigstens einen Stichleitung sowie der wenigstens einen Ringleitung bebozugt jeweils nach oben orientiert angebracht, so dass die auf der Verteilerstruktur aufliegenden Bauteile von dem aus den Austrittsöffnungen austretenden Reinigungsgas unmittelbar beaufschlagt werden. Zur Versorgung der Verteilerstrukturen mit dem Reinigungsgas weisen die vorstehend beschriebenen Manschetten, mit denen die Verteilerstruktur verbunden ist, radial zum Zentralrohr orientierte Gasöffnungen auf, durch die das aus dem Zentralrohr über entsprechende Gasaustrittsöffnungen radial austretende Reinigungsgas in die jeweiligen Verteilerstrukturen gelangen kann. Einzelheiten hierzu können der weiteren Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren entnommen werden.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform sind die jeweiligen Verteilerstrukturen scheibenartig ausgebildet und weisen jeweils eine obere und eine untere Scheibenplatte auf, die einen Zwischenraum einschließen, der zudem von einem die beiden Scheibenplatten an ihrem Umfangsrand flüssig dicht verbindenden Scheibenrand gasdicht umschlossen wird. Das auf diese Weise begrenzte Scheibenvolumen wird über eine dem Zentralrohr zugewandte Öffnung mit dem halogenhaltigen Reinigungsgas gespeist, das zumindest über in der oberen Scheibenplatte eingebrachte Austrittsöffnungen aus dem Scheibenvolumen entweichen kann. Die Anzahl, Anordnung bzw. Ausrichtung sowie die Durchmesser der einzelnen Austrittsöffnungen sind grundsätzlich in weiten Bereichen variabel einstellbar. So sind beispielsweise pro Verteilerstruktur zwischen 100 und 10000 Bohrungen bzw. Austrittsöffnungen jeweils mit Durchmessern zwischen 0,1 mm bis 5 mm vorgesehen.

[0030] Je nach Dimensionierung des Reinigungsreaktors sowie der innerhalb des Reinigungsreaktors zu reinigenden Bauteile haben sich in der Praxis bevorzugte Dimensionen für die Austrittsöffnungen erwiesen, die pro Verteilerstruktur 1000 bis 5000 Austrittsöffnungen jeweils mit Durchmessern zwischen 0,5 und 2,5 mm vorsehen.

[0031] Zu Zwecken einer verbesserten, an die Form und Größe der jeweils zu reinigenden Bauteile angepassten Anströmung mit Reinigungsgas gilt es, die Austrittsöffnungen bezüglich der in der Regel kreisrunden Auflageebene sektorale geeignet anzurichten bzw. zu verteilen, beispielsweise in Form radial verlaufender Linien oder radial und in Umfangsrichtung geordneter Feldmuster, in denen die Austrittsöffnungen gruppenweise zusammengefasst angeordnet sind.

[0032] Neben der Ausbildung der Austrittsöffnungen in Form konventioneller Bohrungen ist es besonders vorteilhaft, die Austrittsöffnungen düsenartig zu konfektionieren, so dass die einzelnen aus den Austrittsöffnungen austretenden Gasströmungen mit einer optimierten Strömungsgeschwindigkeit sowie mit einer vorgebbaren

Ausströmungsrichtung auf das jeweils zu reinigende Bauteil auftreffen. In besonders vorteilhafter Weise dienen hierzu die Gasaustrittsrichtung pro Austrittsöffnung beeinflussende Strömungsleitelemente, die bereits bei der Herstellung der Austrittsöffnungen in geeigneter Weise ausgebildet werden können, beispielsweise im Rahmen formgebender Stanzprozesse.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante sehen die Verteilerstrukturen nicht nur Austrittsöffnungen für das Reinigungsgas an der der Auflageebene zugewandten Oberseite vor, um die auf den jeweiligen Verteilerstrukturen aufliegenden Bauteile mit Reinigungsgas zu beaufschlagen, sondern darüber hinaus sind auch an der gegenüberliegenden Unterseite entsprechende Austrittsöffnungen vorgesehen, um einen Teil des über die Verteilerstruktur austretenden Reinigungsgases auf jene Bauteile zu richten, die auf der unmittelbar darunter befindlichen Auflageebene aufliegen.

[0034] Trotz der Vielzahl an möglichen Ausbildungsvarianten für eine jeweilige Verteilerstruktur kann es bei einzelnen zu reinigenden Komponenten dennoch vorkommen, dass diese nicht optimal vom Reinigungsgas beaufschlagt werden. Um diesen Nachteil zu beseitigen, bietet es sich an, zusätzliche Abdeck-, Ablenk- bzw. Schutzbleche vorzusehen, deren Aufgabe es ist, Gasströme innerhalb des Reinigungsreaktors entsprechend umzulenken. Derartige auch als Gasleitbleche bezeichnete optionale Zusatzkomponenten lassen sich vorzugsweise zwischen den jeweiligen Verteilerstrukturen oder unmittelbar an den zu reinigenden Bauteilen anbringen, um bestimmte Bereiche von Komponenten in besonderer Weise mit dem Reinigungsgas zu beaufschlagen oder aber bestimmte Bereiche gegenüber dem Reinigungsgas abzuschirmen, um einen direkten Kontakt mit dem Reinigungsgas zu vermeiden.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0035] Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisierte Darstellung des Aufbaus eines lösungsgemäß ausgebildeten Reinigungsreaktors,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Verteilerstruktur,

Fig. 3 eine Verteilerstruktur mit plattenförmiger Ausbildung,

Fig. 4 eine Teilschnittdarstellung einer plattenförmig ausgebildeten Verteilerstruktur,

Fig. 5 eine Verteilerstruktur mit segmentartig angeordneten Austrittsöffnungen, sowie

Fig. 6 eine Illustration von Austrittsöffnungen mit Strömungselementen.

Wege zur Ausführung der Erfindung, gewerbliche Verwendbarkeit

[0036] Figur 1 illustriert einen schematischen Aufbau eines Reinigungsreaktors (rechte Figurenhälfte), der über ein Reinigungsgasleitungssystem (linke Figurenhälfte) mit einer Reinigungsgasmischung versorgt wird. Der Reinigungsreaktor weist ein im wesentlichen zylindrisch- oder tonnenförmig ausgebildetes Reaktorgehäuse 11 auf, das an seiner oberen Seite mit einem Reaktordeckel 14 gasdicht verschlossen ist. Das Reaktorgehäuse 11 ist von einem Heizungsmantel 12 umgeben, in dem Heizeinrichtungen 13 für eine Reinigungsprozesstemperatur im Inneren des Reinigungsreaktors von bis zu 1200°C sorgen. Innerhalb des Reinigungsreaktors ist mittig ein Zentralrohr 23 vorgesehen, das den Reaktordeckel 14 gasdicht nach außen durchstößt, und in das über eine Speiseleitung 10 Reinigungsgas eingespeist wird. Zudem ist ein Reaktorauslass 24 innerhalb des Reinigungsreaktors vorgesehen, über den verbrauchtes Reinigungsgas über eine entsprechende Abgasleitung 25 nach außen zur weiteren Ver- bzw. Entsorgung gebracht wird.

[0037] Zur Bereitstellung von Reinigungsgas sind in dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Gasreservoir 1, 1' vorgesehen, nämlich ein Gasreservoir zur Bereitstellung von Fluorwasserstoff (HF) und ein Gasreservoir zur Bereitstellung von Wasserstoffgas (H₂). Beide Gassorten gilt es, in geeigneter Weise vor Einspeisung in die Speiseleitung 10 mit einem vorgegebenen Mischungsverhältnis zu mischen. Hierzu schließt sich längs einer Speiseleitung unmittelbar stromab des HF-Gasreservoirs 1 eine Durchflussregeleinrichtung an, die aus einem Gasmengenregelventil 5, einer Wärmetauscherseinheit 9, vorzugsweise in Form eines Gaserhitzers sowie einer Gasmengenmesseinheit 6 besteht. Die sich unmittelbar stromab zum Gasmengenregelventil 5 anschließende Wärmetauscherseinheit 9 sorgt für eine markante Temperaturerhöhung über die Kondensationstemperatur des HF-Gases, so dass eine von jedweden Kondensationsprozessen nicht beeinträchtigte HF-Gasversorgung mit Hilfe der Durchflussregeleinrichtung gewährleistet werden kann. Zur Überwachung und Ansteuerung der Wärmetauscherseinheit 9 dient ein Gasmtemperaturregelkreis 8. Zur kontrollierten Durchführung der Gasmengenmessung ist ein geeigneter Gasmengenregelkreis 7 vorgesehen.

[0038] Um bei einem eventuellen Ausfall der automatischen Regelung hinsichtlich der Gastemperatur und/oder der Gasmenge einen damit verbundenen Prozessabbruch zu vermeiden, ist zusätzlich eine Bypassleitung 2 vorgesehen, in der ein Absperrventil, vorzugsweise ein Handregelventil 4, angebracht ist. Die Bypassleitung 2 wird in jenem Fall genutzt, bei dem die Durchflussregeleinrichtung, bestehend aus dem Gasmengen-

regelventil 5 der Wärmetauschereinheit 9 und der Gasmengenmesseinheit 6, stromauf und stromab mit Hilfe zweier Blockventile 3 von der Gaszufuhr abgetrennt wird. Die eingesetzten Blockventile 3 können vorzugsweise in Form von Ventilen, Hähnen oder Schiebern ausgebildet sein, die sowohl von Hand als auch automatisch angetrieben werden können.

[0039] Das in der Bypassleitung 2 vorgesehene Handregelventil ist vorzugsweise als Nadeldurchgangsventil ausgebildet, das eine sehr fein dosierte Einstellung des HF-Gasflusses ermöglicht.

[0040] Das längs der Speiseleitung 10 in das Zentralrohr 23 eingespeiste HF-Reinigungsgasmisch tritt innerhalb des Prozessraumes 16 des Reinigungsreaktors über in verschiedenen Ebenen längs des Zentralrohrs 23 angebrachte Verteilerstrukturen 20 aus, auf denen die jeweils zu reinigenden Bauteile 26 aufliegen. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind die im Prozessraum 16 vorgesehenen Verteilerstrukturen 20 getrennt zu gleichfalls radial am Zentralrohr 23 angebrachten Stützstrukturen 19 ausgeführt, auf denen sich die Verteilerstrukturen 20 abstützen. Das Reinigungsgas gelangt über das Zentralrohr 23 jeweils in die Verteilerstrukturen 20, von denen es unmittelbar auf die zu reinigenden Bauteile 26 gerichtet austritt. Zusätzliche innerhalb des Prozessraums 16 vorgesehene Gasleitbleche 27, 28 und 29 sorgen für eine individuelle Anströmung der einzelnen zu reinigenden Bauteile 26 mit Reinigungsgas.

Im Bereich des Reaktorsumpfes 17 befindet sich die unterste Verteilerstruktur 20, die in einen stabilen Bodenträger 21 integriert ist, der vorzugsweise fest mit dem Zentralrohr 23 verbunden ist.

[0041] Um den Bereich des Reaktorkopfes 15, insbesondere den Reaktordeckel 14 gegenüber einer zu starken Hitzebelastung zu bewahren, ist ein Hitzeschild 22 im oberen Bereich innerhalb des Reinigungsreaktors am Zentralrohr 23 angebracht.

[0042] In Figur 2 ist in perspektivischer Darstellung eine bevorzugte Ausführungsform einer Verteilerstruktur 20 dargestellt. Die Verteilerstruktur 20 weist eine mittige Manschette 43 auf, die über das nicht weiter dargestellte Zentralrohr zwangsgeführte geschoben werden kann. Nur der Vollständigkeit sei darauf hingewiesen, dass anstelle der Manschette die Verteilerstruktur 20 auch direkt mit dem Zentralrohr 23 verbunden sein kann, in diesem Fall entspricht die Komponente 43 dem Zentralrohr.

[0043] Radial von der Manschette 43 ausgehend schließen an diese vier Stichleitungen 40 an, mit denen jeweils konzentrische Ringleitungen 41 verbunden sind. Die Stichleitungen 40 sowie Ringleitungen 41 bilden ein miteinander kommunizierendes Rohrleitungssystem, das von dem nicht dargestellten Zentralrohr 23 mit Reinigungsgas versorgt wird. Hierzu weist die Manschette 43 Öffnungen auf (nicht dargestellt) über die das vom Zentralrohr 23 bereitgestellte Reinigungsgas in das Verteilersystem eingespeist werden kann. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Verteilerstruktur 20 eigentragfähig und robust ausgebildet und fest genug mit der

Manschette 43 verbunden, um sowohl das Eigengewicht der Verteilerstruktur 20 sowie auch das Gewicht der auf die Verteilerstruktur 20 aufzubringenden zu reinigenden Bauteile 26 aufzunehmen.

5 Nicht in Figur 2 dargestellt sind die längs der Stichleitungen 40 sowie Ringleitungen 41 vorgesehenen Austrittsöffnungen, über die das Reinigungsgas in Richtung der auf der Verteilerstruktur 20 aufliegenden Bauteile austritt.

10 **[0044]** Figur 3 illustriert stark schematisiert ein alternatives Ausführungsbeispiel für eine Verteilerstruktur, die plattenförmig ausgebildet ist. Die Verteilerstruktur weist in diesem Fall eine obere 50 und untere 51 Scheibenplatte auf, beide Platten 50 und 51 sind von einem 15 umlaufenden Scheibenrand 52 begrenzt und schließen ein innenliegendes Volumen ein. Zusätzlich ist die Verteilerstruktur mit einer mechanisch stabilen Stützstruktur 54 verbunden. Die obere Scheibenplatte 50 weist Sektoren auf, gekennzeichnet durch Begrenzungslinien 55, die im dargestellten Falle längs jeweils radial verlaufen. Die einzelnen Sektoren können ausgetauscht werden, um den Reaktor möglichst variabel an unterschiedliche Komponententypen anzupassen. Mittig wird die plattenförmig ausgebildete Verteilerstruktur von dem Zentralrohr 23 durchsetzt, an dem die Verteilerstruktur 20 fest angebracht ist. Alternativ ist die Verteilerstruktur mit einer vorstehend beschriebenen Manschette verbunden, die über das Zentralrohr 23 gefädelt ist.

[0045] In Figur 4 ist eine perspektivische Querschnittsdarstellung durch eine plattenförmig ausgebildete Verteilerstruktur dargestellt. In diesem Falle sei angenommen, dass die obere und die untere Scheibenplatte 50, 51 unmittelbar an dem zentralen Zentralrohr 23 angebracht sind. Ebenfalls kann es sich bei 23 um eine Manschette handeln. Über entsprechende Verbindungsöffnungen 55 gelangt durch das Zentralrohr bzw. Manschette 23 zugeführtes Reinigungsgas in den Zwischenraum zwischen der oberen und unteren Scheibenplatte 50, 51. Über entsprechende Austrittsöffnungen 56, die in der oberen Scheibenplatte 50 eingearbeitet sind, tritt das Reinigungsgas schließlich in den Prozessraum aus. Die Austrittsöffnungen 56 werden vorzugsweise unter Berücksichtigung der zu reinigenden Bauteile, die auf der oberen Scheibenplatte 50 aufzubringen sind, entsprechend angeordnet. Das in Figur 4 dargestellte Ausführungsbeispiel sieht sektorale feldartige Ordnungsmuster für die Austrittsöffnungen 56 vor. In Figur 5 ist die Draufsicht einer Segmentfläche der oberen Scheibenplatte 50 dargestellt, in der eine Vielzahl von Feldern 57 angeordnet sind, die sich jeweils aus einer Vielzahl einzelner Austrittsöffnungen 56 zusammensetzen. Die Anordnung sowie die Anzahl der Austrittsöffnungen 56 innerhalb der einzelnen Felder 57 können jeweils identisch oder unterschiedlich, vorzugsweise in Abhängigkeit an die jeweils zu reinigenden Bauteile gewählt werden.

[0046] Figur 6 zeigt schematisiert eine vergrößerte Darstellung eines Feldes 57, in dem eine Vielzahl einzelner Austrittsöffnungen 56 vorgesehen ist. Anhand der

Schnittbilddarstellungen A-A sowie B-B sind die Konturen der einzelnen Austrittsöffnungen ersichtlich. Insbesondere kann aus der Schnittdarstellung A-A ersehen werden, dass jede einzelne Austrittsöffnung 56 von einem Strömungsleitelement 58 überdeckt ist, wodurch die Austrittsströmung räumlich gerichtet auf das jeweilige Bauteil auftreffen kann.	3	Blockventil
	4	Handregelventil
	5	Gasmengenregelventil
	6	Gasmengenmesseinheit
	5	Regelkreis für Gasmenge
	7	Regelkreis für Gastemperatur
	8	Wärmetauschereinheit
	9	Speiseleitung
	10	Reinigungsreaktor
	11	Heizungseinheit
	10	Heizungen
	12	Reaktordeckel
	13	Reaktorkopf
	14	Prozessraum
	15	Reaktorsumpf
	16	Reaktorboden
	15	Stützstruktur
	17	Verteilerstruktur
	18	Stützstruktur-Bodenträger
	19	Hitzeschild
	20	Zentralrohr
	21	Reaktorauslass
	22	Abgasleitung
	23	Bauteil
	24	Gasleitbleche
	25	Stichleitung
	26	Ringleitung
	25	Verbindungsstellen
	27,28, 29	Manschette
	40	obere Scheibenplatte
	41	untere Scheibenplatte
	42	Scheibenrahmen
	43	Stützstruktur
	30	Verbindungsöffnung
	50	Austrittsöffnungen
	51	Feld von Austrittsöffnungen 56
	52	Strömungsleitelement
	53	Sektorblech
	40	

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Reinigung oxidiert oder korrodierter Bauteile (26), insbesondere von Heissgasen beaufschlagter Turbinenkomponenten, in Gegenwart eines halogenhaltigen Gasgemisches, umfassend einen Reinigungsreaktor (11), in den mittel- oder unmittelbar eine Speiseleitung (10) mündet, die über eine Durchflussregeleinrichtung (7) mit einem das halogenhaltige Gas bevoorratenden Gasreservoir (1) verbunden ist, wobei die Durchflussregeleinrichtung (7) in Abfolge längs der Durchströmungsrichtung des die Speiseleitung (10) durchströmenden halogenhaltigen Gases ein Gasmengenregelventil (5) und eine Wärmetauschereinheit (9) vorsieht, **durch gekennzeichnet, dass** die Durchflussregeleinrichtung (7) eine Gasmengenmesseinheit (6) vorsieht, dass ein mit der wenigstens einen Speiselei-

Bezugszeichenliste

[0049]

1	Gasreservoir
2	Bypassleitung

tung (10) mittel- oder unmittelbar verbundenes Zentralrohr (23) vorgesehen ist, das sich von einem Reaktorkopf (15) bis zu einem Reaktorsumpf (17) innerhalb des Reinigungsreaktors (11) erstreckt und im Bereich des Reaktorsumpfes (17) mit einer sich radial zum Zentralrohr (23) erstreckenden, ersten Verteilerstruktur (19) verbunden ist, die über Austrittsöffnungen (56) für das halogenhaltige Gasgemisch verfügt,
 dass die erste Verteilerstruktur (20) eine Auflageebene für die zu reinigenden Bauteile (26) vorsieht,
 dass eine zweite Verteilerstruktur (20) vorgesehen ist, die beabstandet zur ersten Verteilerstruktur am Zentralrohr (23) angeordnet ist und eine sich radial zum Zentralrohr (23) erstreckende Auflageebene für die zu reinigenden Bauteile (26) vorsieht, und
 dass die Verteilerstrukturen (20) zumindest in Richtung der auf ihnen aufliegenden Bauteile (26) zugewandt orientierte Austrittsöffnungen (56) für das halogenhaltige Gas besitzen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** stromauf und stromab zur Durchflussregeleinrichtung in der Speiseleitung jeweils ein Absperrventil (3) vorgesehen ist, und
 dass eine Bypassleitung (2) zur Durchflussregeleinrichtung längs der Speiseleitung vorgesehen ist, längs der ein Regelventil (4) eingebracht ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Absperrventile (3) jeweils als Blockventil ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Regelventil (4) als Handregelventil ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wärmetauscherinheit (9) eine elektrische Beheizung aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das halogenhaltige Gas Fluorwasserstoffgas ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Speiseleitung (10) vor Eintritt in den Reinigungsreaktor in eine in den Reinigungsreaktor führende Zuleitung mündet, in die vor Eintritt in den Reinigungsreaktor wenigstens eine zweite Speiseleitung mündet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Speiseleitung mit einem Wasserstoffgasreservoir (1') verbunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** weitere 5 Verteilerstrukturen (20) längs des Zentralrohrs (23) jeweils voneinander beabstandet angeordnet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite und die weiteren Verteilerstrukturen (20) Austrittsöffnungen (56) für das halogenhaltige Gas aufweisen, die auf die längs des Zentralrohrs (23) unmittelbar benachbarte Verteilerstruktur (20) gerichtet sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Verteilerstruktur (20) sowie weitere Verteilerstrukturen platten- oder gitterförmig ausgebildet sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verteilerstruktur (20) wenigstens eine von dem Zentralrohr (23) radial verlaufende Stichleitung (40) besitzt, von der radial zum Zentralrohr (23) beabstandet wenigstens eine das Zentralrohr (23) ringförmig umlaufende Ringleitung (41) abgeht, und
 dass die Austrittsöffnungen (56) längs der wenigstens einen Stichleitung (40) sowie der wenigstens einen ringförmigen Ringleitung (41) angebracht sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Stich- und Ringleitungen (40, 41) aus einem formstabilen Rohrmaterial gefertigt sind, und
 dass die Stich- und Ringleitungen (40, 41) eine spinennetzartige Auflageebene beschreiben, auf die die zu reinigen Bauteile (26) unmittelbar auflegbar sind.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verteilerstruktur (20) scheibenartig das Zentralrohr (23) umgibt und mit einer oberen und unteren Scheibenplatte (50, 51) sowie einem beide Scheibenplatten (50, 51) an ihrem Umfangsrand (53) fluiddicht verbindenden Scheibenrand ein Scheibenvolumen einschließt,
 dass das Scheibenvolumen über wenigstens eine dem Zentralrohr (23) zugewandte Öffnung (25) in der Verteilerstruktur mit dem halogenhaltigen Gas speisbar ist, und
 dass zumindest die obere Scheibenplatte (50) Austrittsöffnungen (56) für das halogenhaltige Gas besitzt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** an den Austrittsöffnungen (56) jeweils die Gasaustrittsrichtung beeinflussende Strömungsleitelemente (58) vorgesehen sind.

16. Vorrichtung nach den Ansprüchen 14 und 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** die obere Scheibenplatte (50) Ausnehmungen vorsieht, in die modularig ausgebildete Sektorbleche (59) einlegbar sind, und
dass die Sektorbleche (59) individuell vorgebbare Muster an Austrittsöffnungen (56) vorsehen.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verteilerstruktur (20) mit einer radial innenliegenden Manschette (43) verbunden ist, die als Trag- und Stützstruktur dient, und
dass die Manschette (43) eine Öffnung zur Aufnahme des Zentralrohrs (23) besitzt, längs der die Manschette (43) zwangsgeführt fixierbar ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Anzahl von zylinderförmigen Distanzmanschetten längs des Zentralrohrs (23) zu Zwecken einer gegenseitigen Beabstandung zweier Verteilerstrukturen (20) längs des Zentralrohrs (23) vorgesehen ist.

Claims

1. Device for cleaning oxidized or corroded components (26), especially turbine components which are exposed to impingement by hot gases, in the presence of a halogenous gas mixture, comprising a cleaning retort (11) into which indirectly or directly leads a feed line (10) which is connected via a flow control unit (7) to a gas reservoir (1) which stores the halogenous gas, wherein the flow control unit (7) provides a gas volume control valve (5) and a heat exchanger unit (9) in sequence along the through-flow direction of the halogenous gas which flows through the feed line (10) **characterized in that** the flow control unit (7) provides a gas volume measuring unit (6), **in that** a central pipe (23) is provided, which is connected indirectly or directly to the at least one feed line (10), extends from the retort head (15) to a retort sump (17) inside the cleaning retort (11), and in the region of the retort sump (17) is connected to a first distribution structure (19) which extends radially to the central pipe (23) and has discharge openings (56) for the halogenous gas mixture, **in that** the first distribution structure (20) provides a support surface for the components (26) which are to be cleaned,
in that a second distribution structure (20) is provided, which is arranged on the central pipe (23) at a distance from the first distribution structure and provides a support surface, which extends radially to the central pipe (23), for the components (26) which are to be cleaned, and
in that the distribution structures (20) have dis-

charge openings (56) for the halogenous gas, which are oriented at least in the direction of, and facing, the components (26) which lie upon them.

5 2. Device according to Claim 1, **characterized in that** a shut-off valve (3) is provided in each case in the feed line upstream and downstream to the flow control unit, and
in that a bypass line (2) to the flow control unit is provided along the feed line, along which bypass line a control valve (4) is introduced.

10 3. Device according to Claim 2, **characterized in that** the shut-off valves (3) are designed as a block valve in each case.

15 4. Device according to either of Claims 2 or 3, **characterized in that** the control valve (4) is designed as a hand control valve.

20 5. Device according to one of Claims 1 to 4, **characterized in that** the heat exchanger unit (9) has an electric heater.

25 6. Device according to one of Claims 1 to 5, **characterized in that** the halogenous gas is hydrogen fluoride gas.

30 7. Device according to one of Claims 1 to 6, **characterized in that** the feed line (10), before entry into the cleaning retort, leads into an inlet line which leads into the cleaning retort, into which inlet line at least one second feed line leads before entry into the cleaning retort.

35 8. Device according to Claim 7, **characterized in that** the second feed line is connected to a hydrogen gas reservoir (1').

40 9. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** additional distribution structures (20) are arranged along the central pipe (23) at a distance from each other in each case.

45 10. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** the second and the additional distribution structures (20) have discharge openings (56) for the halogenous gas which are directed onto the distribution structure (20) which is directly adjacent along the central pipe (23).

50 11. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** the first distribution structure (20) and also additional distribution structures are designed in plate form or grid form.

55 12. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** the distribution structure (20)

has at least one branch pipe (40) which extends radially from the central pipe (23) and from which projects at least one circular pipe (41) which is radially at a distance from the central pipe (23) and annularly encompasses the said central pipe (23), and **in that** the discharge openings (56) are applied along the at least one branch pipe (40) and also along the at least one annular circular pipe (41).

13. Device according to Claim 12, **characterized in that** the branch pipes and circular pipes (40, 41) are manufactured from a dimensionally stable tubular material, and **in that** the branch pipes and circular pipes (40, 41) describe a spider's web-like support surface upon which the components (26) which are to be cleaned can be directly placed. 10

14. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** the distribution structure (20) encompasses the central pipe (23) like a disk and by an upper and lower disk plate (50, 51), and also a disk rim which connects the two disk plates (50, 51) in a fluidtight manner on their peripheral edge (53), include a disk volume, **in that** the disk volume can be fed with the halogenous gas via at least one opening (25), which faces the central pipe (23), in the distribution structure, and **in that** at least the upper disk plate (50) has discharge openings (56) for the halogenous gas. 15 20 25

15. Device according to Claim 14, **characterized in that** flow guiding elements (58) which influence the gas discharge direction are provided in each case at the discharge openings (56). 30 35

16. Device according to Claims 14 and 15, **characterized in that** the upper disk plate (50) provides recesses into which sector plates (59), which are designed like modules, can be inserted, and **in that** the sector plates (59) individually provide predetermined patterns at the discharge openings (56). 40 45

17. Device according to one of the preceding claims, **characterized in that** the distribution structure (20) is connected to a radially inner collar (43) which serves as a bearing and support structure, and **in that** the collar (43) has an opening for accommodating the central pipe (23), along which the collar (43) can be fixed in a force-guided manner. 50

18. Device according to Claim 17, **characterized in that** a number of cylindrical distance sleeves are provided along the central pipe (23) for purposes of a mutual spacing of two distribution structures (20) along the central pipe (23). 55

Revendications

1. Dispositif pour nettoyer des composants oxydés ou corrodés (26), en particulier de composants de turbine exposés à des gaz chauds, en présence d'un mélange gazeux halogéné, comprenant un réacteur de nettoyage (11), dans lequel débouche, directement ou indirectement, une conduite d'alimentation (10) qui par l'intermédiaire d'un dispositif (7) de régulation du débit est reliée à un réservoir de gaz (1) stockant le gaz halogéné, le dispositif (7) de régulation du débit prévoyant, successivement le long de la direction de l'écoulement du gaz halogéné passant par la conduite d'alimentation (10), une vanne (5) de régulation de la quantité du gaz et une unité d'échange de chaleur (9), **caractérisé en ce que** le dispositif (7) de régulation du débit prévoit une unité (6) de mesure de la quantité de gaz ; qu'un tube central (23) est prévu, directement ou indirectement relié à la ou aux conduites d'alimentation (10), tube central qui s'étend d'une tête (15) du réacteur à un fond (17) du réacteur à l'intérieur du réacteur de nettoyage (11) et est, dans la zone du fond (17) du réacteur, relié à une première structure de répartition (19), s'étendant radialement par rapport au tube central (23), et disposant d'ouvertures de sortie (56) pour le mélange gazeux halogéné ; que la première structure de répartition (20) prévoit un plan formant support pour les composants à nettoyer (26) ; qu'une deuxième structure de répartition (20) est prévue, qui est disposée à distance de la première structure de répartition contre le tube central (23) et prévoit pour les composants (26) à nettoyer un plan formant support, s'étendant radialement par rapport au tube central (23) ; et que les structures de répartition (20) possèdent des ouvertures de sortie (56) pour le gaz halogéné, orientées en étant dirigées au moins dans la direction des composants (26) qui sont supportées par elles. 60

2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce qu'** une vanne d'arrêt (3) est prévue tant en amont qu'en aval du dispositif de régulation du débit dans la conduite d'alimentation, et qu'une conduite d'évitement (2) est prévue pour le dispositif de régulation du débit le long de la conduite d'alimentation, le long de laquelle est insérée une vanne de régulation (4). 65

3. Dispositif selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** chaque vanne d'arrêt (3) est conçue comme un robinet-vanne de sectionnement. 70

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, **caractérisé en ce que** la vanne de régulation (4) est conçue comme une vanne de régulation manuelle. 75

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, **ca-**

ractérisé en ce que l'unité d'échange de chaleur (9) comprend un chauffage électrique.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce que** le gaz halogéné est du fluorure d'hydrogène gazeux. 5

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, **caractérisé en ce que** la conduite d'alimentation (10) débouche, avant de pénétrer dans le réacteur de nettoyage, dans une conduite d'amenée conduisant au réacteur de nettoyage, dans laquelle au moins une deuxième conduite d'alimentation débouche en amont de l'entrée dans le réacteur de nettoyage. 10

8. Dispositif selon la revendication 7, **caractérisé en ce que** la deuxième conduite d'alimentation est reliée à un réservoir (1') d'hydrogène gazeux. 15

9. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** d'autres structures de répartition (20), écartées les unes des autres, sont disposées le long du tube central (23). 20

10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la deuxième et les autres structures de répartition (20) comportent des ouvertures de sortie (56) pour le gaz halogéné, qui sont dirigées vers la structure de répartition (20) immédiatement voisine le long du tube central (23). 25

11. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la première structure de répartition (20), ainsi que les autres structures de répartition, sont conçues en forme de plaque ou de grille. 30

12. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la structure de répartition (20) possède au moins une conduite de dérivation (40) courant radialement à partir du tube central (23), conduite de dérivation dont part au moins une conduite annulaire (41) entourant d'une manière annulaire le tube central (23), radialement écartée du tube central (23), et que les ouvertures de sortie (56) sont disposées le long de la ou des conduites de dérivation (40), ainsi que de la ou des conduites annulaires de forme annulaire (41). 35

13. Dispositif selon la revendication 12, **caractérisé en ce que** les conduites de dérivation et les conduites annulaires (40, 41) sont fabriquées en un matériau de tube indéformable, et que les conduites de dérivation et les conduites annulaires (40, 41) décrivent un plan formant support de type toile d'araignée, sur lequel les composants (26) à nettoyer peuvent être directement posés. 40

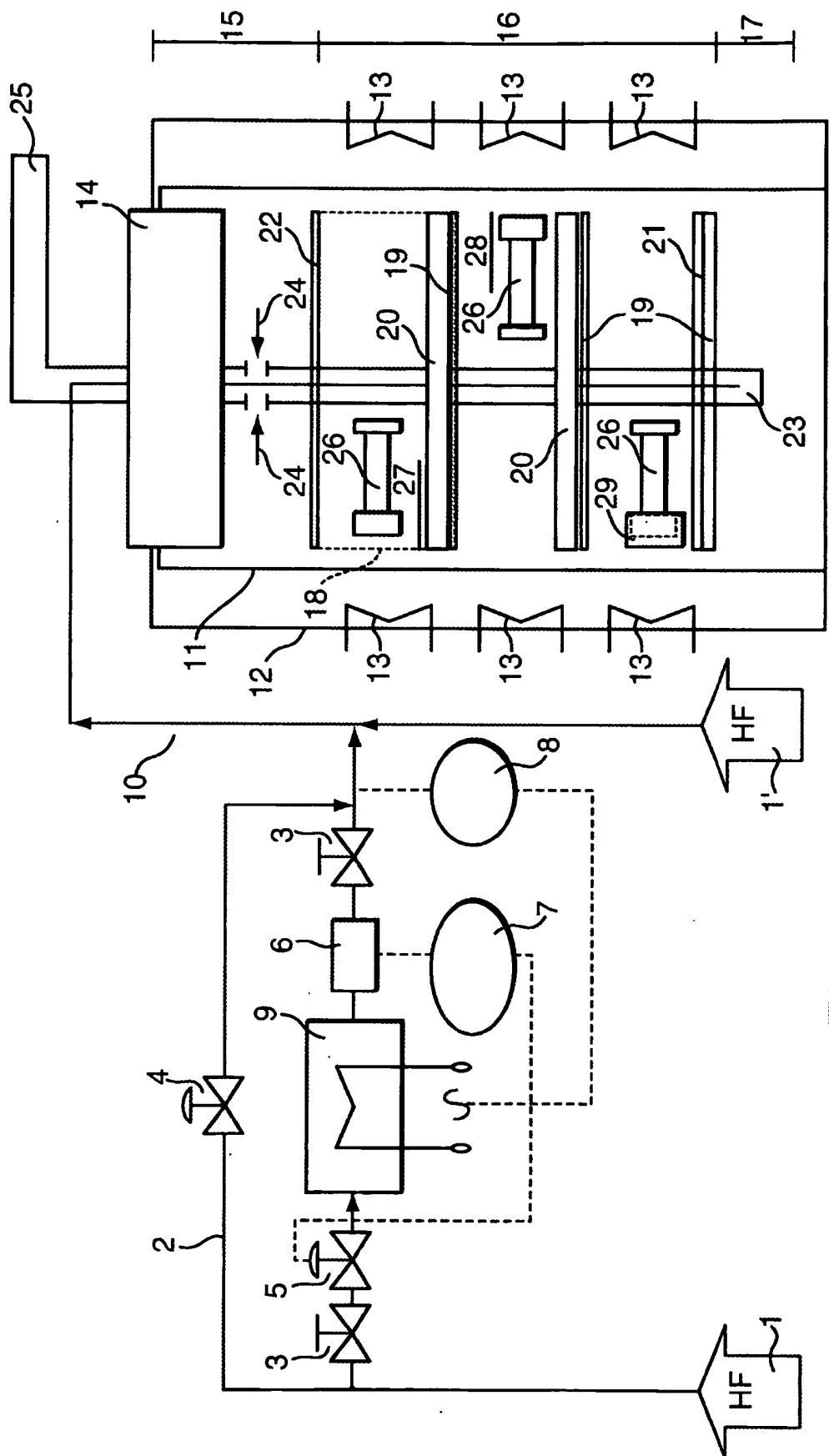
14. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la structure de répartition (20) entoure comme un disque le tube central (23) et, avec une plaque supérieure et inférieure (50, 51) en forme de disque, ainsi qu'avec un bord de disque, reliant d'une manière étanche aux fluides les deux plaques en forme de disque (50, 51) au niveau de leur bord périphérique (53), enferme un volume de disque ; que le volume de disque peut être alimenté en le gaz halogéné par l'intermédiaire d'au moins une ouverture (25), dirigée vers le tube central (23), dans la structure de répartition, et qu'au moins la plaque supérieure (50) en forme de disque possède des ouvertures de sortie (56) pour le gaz halogéné. 45

15. Dispositif selon la revendication 14, **caractérisé en ce qu'**au niveau de chacune des ouvertures de sortie (56) sont prévus des éléments de guidage d'écoulement (58), qui influent sur la direction de sortie du gaz. 50

16. Dispositif selon les revendications 14 et 15, **caractérisé en ce que** la plaque supérieure (50) en forme de disque prévoit des évidements, qui peuvent être aménagés dans des tôles formant secteur (59), de conception modulaire, et que les tôles (59) formant secteur prévoient au niveau des ouvertures de sortie (56) des modèles individuellement prédéfinissables. 55

17. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la structure de répartition (20) est reliée à une manchette (43), qui sert de structure de soutènement et d'appui, et que la manchette (43) possède une ouverture pour recevoir le tube central (23), le long duquel la manchette (43) est fixée avec guidage à force. 60

18. Dispositif selon la revendication 17, **caractérisé en ce qu'**un certain nombre de manchettes d'écartement cylindriques sont prévues le long du tube central (23) pour permettre un écartement réciproque de deux structures de répartition (20) le long du tube central (23). 65



正

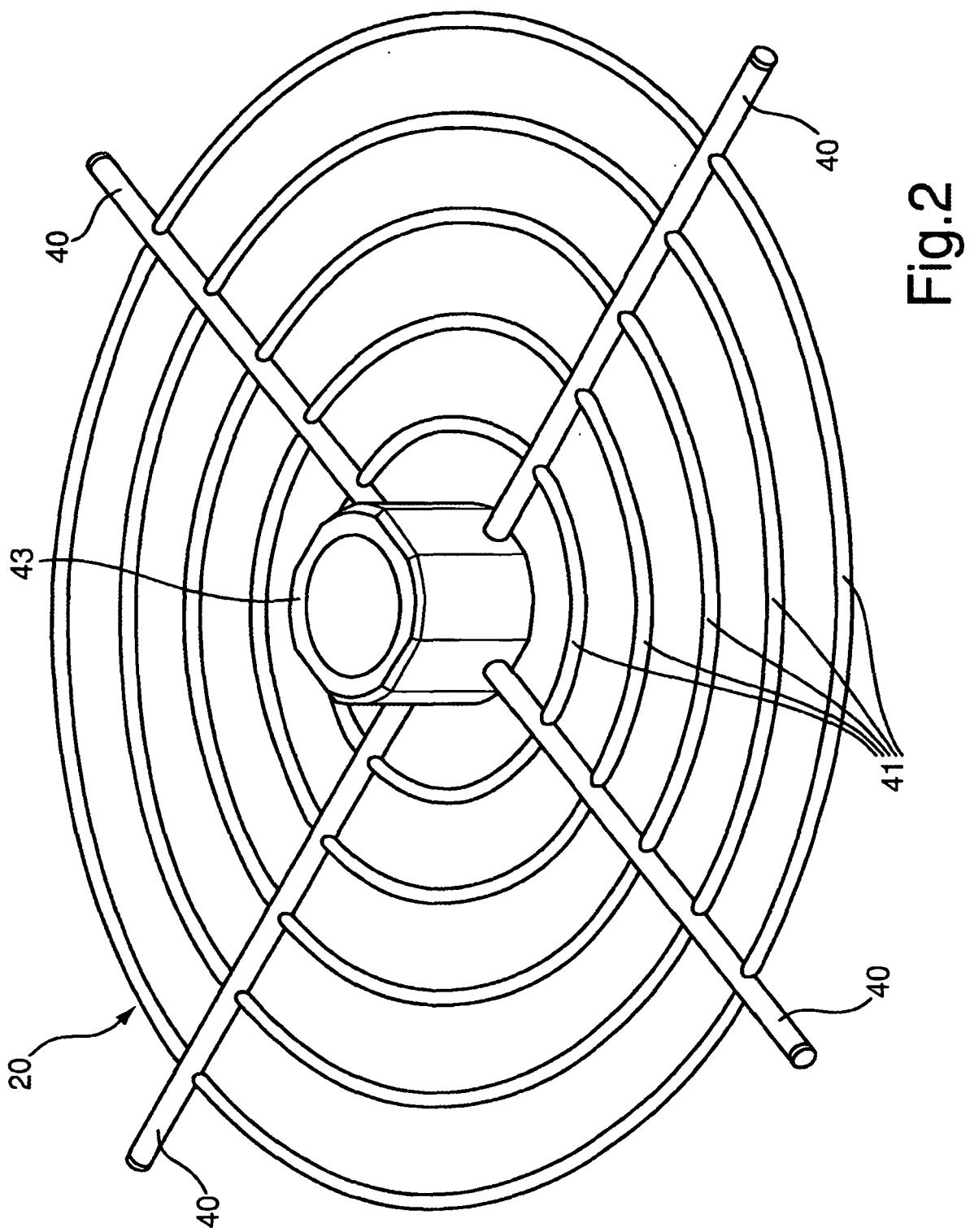


Fig.2

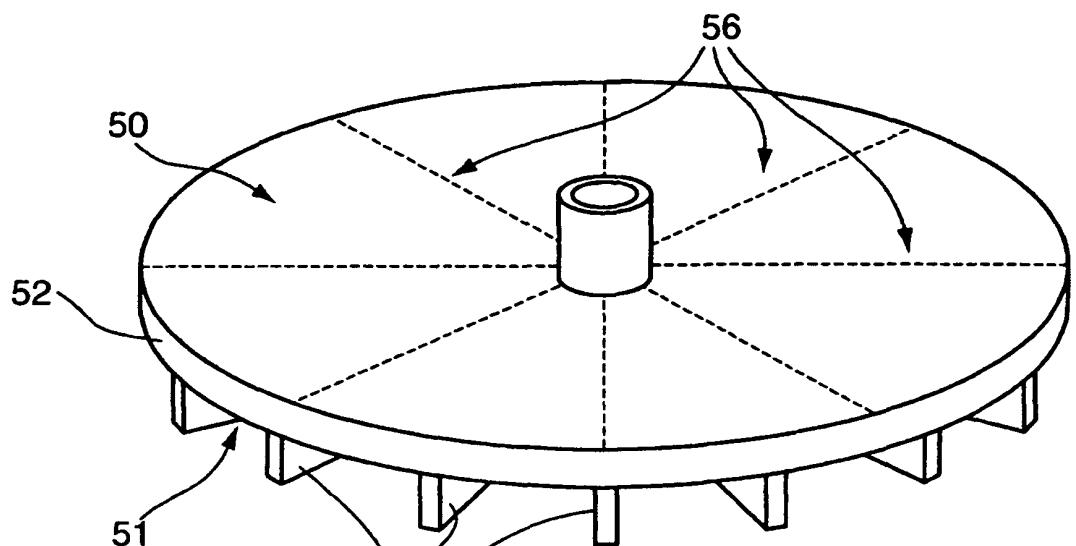


Fig. 3

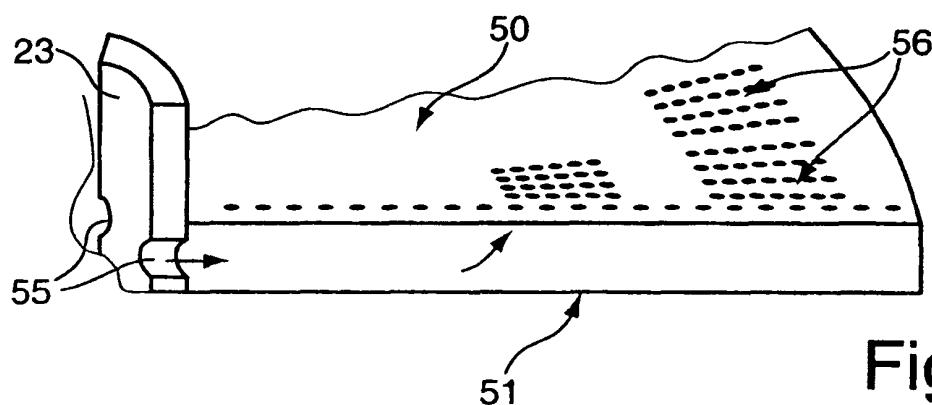


Fig. 4

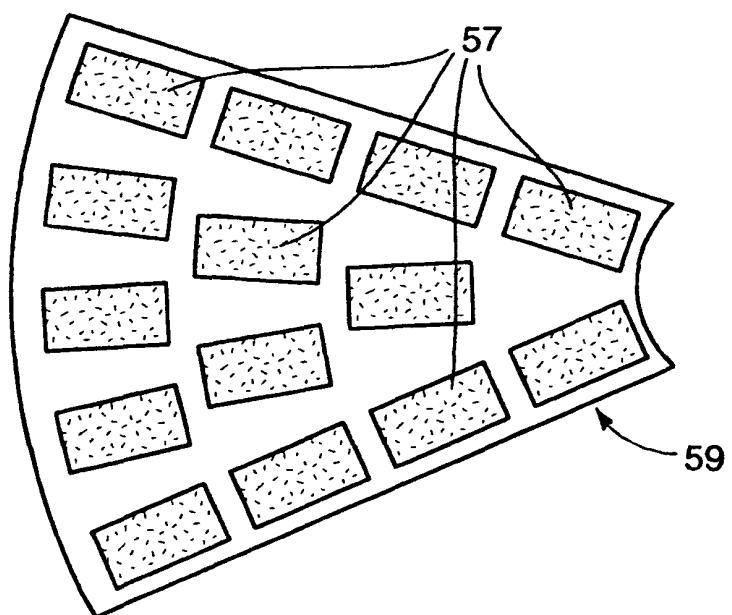


Fig. 5

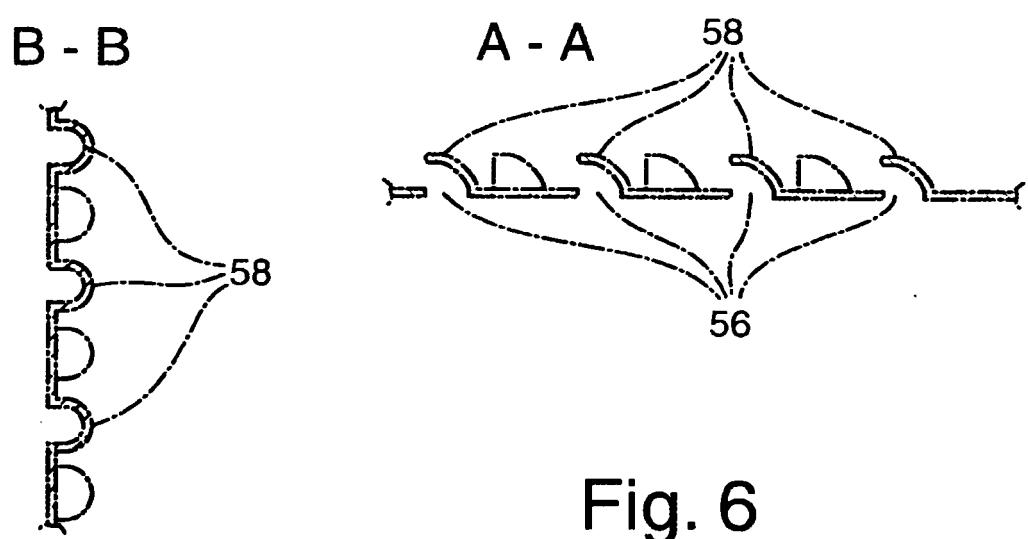
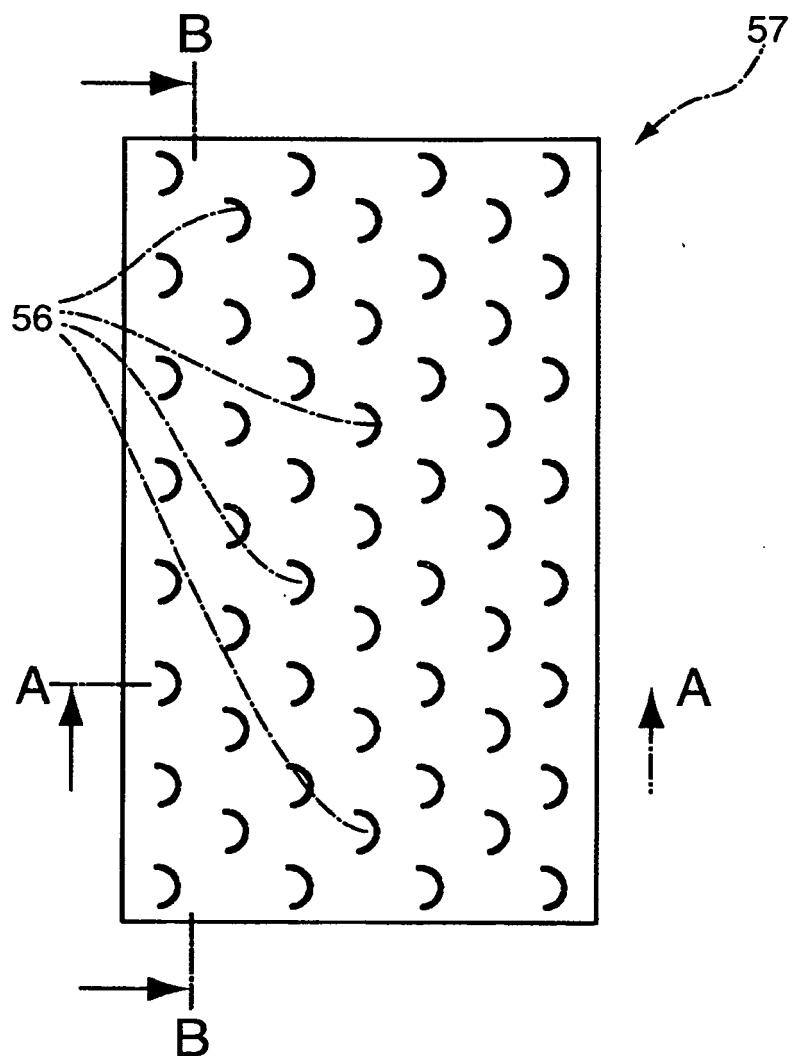


Fig. 6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 2810598 A1 [0004]
- JP 2001003705 A [0004]
- EP 0209307 B1 [0004] [0007]
- EP 1882823 A2 [0005]
- DE 102005051310 A1 [0008]
- US 6536135 B2 [0009] [0012] [0024]